

## Unendlich korrigiertes Plan-APO-Objektiv für SWIR, 10X



SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective

Produkt #26-219 **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €4.250<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€4.250,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

335 **Gewicht (g):**

### Optische Eigenschaften

20.00 **Brennweite BW (mm):**

10X **Vergrößerung:**

**Numerische Apertur NA:**

0.27

**Auflösung (µm):**

2.5

**Tiefenschärfe (µm):**

7.50

**Deckglaskorrektur:**

Not Available

**Arbeitsabstand (mm):**

30.4

**Wellenlängenbereich (nm):**

550 - 1600

**Max. Bildkreis (mm):**

24.00

## Gewinde & Montage

**Gewinde:**

M26

## Konformität mit Standards

**Konformitätszertifikat:**

[Anzeigen](#)

## Produktdetails

- Hohe Auflösung für kurzwelliges Infrarot bis 1600 nm
- Vergrößerungen von 1X bis 50X
- Ideal für Detektion von Photoemission, Lasermarkierung und Laserschneiden

Die unendlich korrigierten Plan-APO-Objektive für SWIR sind hochauflösende Objektive mit langen Arbeitsabständen, die für einen Bereich zwischen 800 und 1600 nm farbkorrigiert sind. Die Objektive haben hohe numerische Aperturen, die hochaufgelöste Bilder bei SWIR-Wellenlängen ermöglichen, und sind mit Vergrößerungen von 1X bis 50X verfügbar. Die Objektive besitzen eine Parfokallänge von 95 mm und können mit einer Tubuslinse mit 200 mm Brennweite und einer kompatiblen [C-Mount-Kamera](#) kombiniert und einfach in Systeme integriert werden. Die unendlich korrigierten Plan-APO-Objektive für SWIR sind ideal für die Detektion von Photoemission, die Inspektion von Waferrückseiten, Laserschneiden von Glas und die Laser-Scanning-Mikroskopie.